DIN 50455-1:2009-10 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Verfahren zur Charakterisierung von Fotolacken - Teil 1: Bestimmung der Schichtdicke mit optischen Messverfahren

Inhalt

Seite

Vorwort ... 3
Einleitung ... 4
1 Anwendungsbereich ... 4
2 Normative Verweisungen ... 4
3 Kurzbeschreibung ... 4
4 Einheiten ... 4
5 Geräte und Materialien ... 5
6 Durchführung ... 5
6.1 Allgemeines ... 5
6.2 Probenherstellung ... 6
6.2.1 Umgebungsbedingungen ... 6
6.2.2 Herstellverfahren ... 6
6.3 Messung der Schichtdicke ... 6
7 Auswertung ... 7
7.1 Allgemeines ... 7
7.2 Absolutverfahren ... 7
7.3 Differenzverfahren ... 8
8 Präzision ... 8
9 Prüfbericht ... 8

Bilder

Bild 1 — Beispiel eines Messstellenplanes ... 7